PRESS RELEASE



各位

2024年12月11日 太陽ホールディングス株式会社

太陽ホールディングス「SEMICON Japan 2024」出展のお知らせ

imecと共同開発中の半導体ウエハレベルパッケージ用絶縁材料や 高透明・高耐熱PFASフリーフィルム含む最新の研究開発製品を展示

太陽ホールディングス株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:佐藤 英志、証券コード:4626、以下、「太陽ホールディングス」) は、2024年12月11日(水)~13日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される、SEMICON Japan 2024に出展します。ブース内では、太陽ホールディングス研究部門の取り組む、半導体ウエハレベルパッケージの高解像度感光性絶縁材料や高透明・高耐熱PFASフリーフィルムをはじめとする、最先端技術の発展に貢献する各種研究開発品を展示します。



■「SEMICON Japan 2024」開催概要

開催期間:2024年12月11日(水)~13日(金)10:00~17:00

会 場:東京ビッグサイト 東1ホール

小 間 番 号:1538

展示会詳細: https://www.semiconjapan.org/jp

当社出展概要: https://x.gd/q5Sh6

主な展示内容 : 高解像度感光性絶縁材料、高耐熱・高解像度フォトレジスト、高透明・高耐熱PFASフリーフィルム

■出展製品情報

【高解像度感光性絶縁材料①】

製品概要:高解像度、高絶縁信頼性を持つ、低温硬化、アルカリ現像タイプの絶縁材料。

用 途:次世代再配線層

【高解像度感光性絶縁材料②】 ※imec共同開発品:世界最大級の半導体研究機関imecの3Dプログラムへ参加 し、RDL微細化の共同開発をしています。

製品概要:プロセス適応性と面内均一性、高解像性を持つ、アルカリ現像タイプの絶縁材料。

用 途:再配線層用絶縁膜 【高耐熱・高解像度フォトレジスト】

製品概要:高耐熱、高解像性を持つネガ型感光材、アルカリ現像型のフォトレジスト。

用 途:パワー半導体製造工程

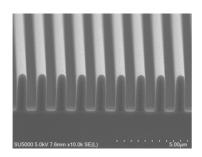
【高透明・高耐熱PFASフリーフィルム】

製品概要:PFAS不使用、高耐熱性、無色透明性、耐衝撃性を持つフィルム。 用 途:透明FPC、フレキシブル太陽電池、スマートグラス、タッチセンサー

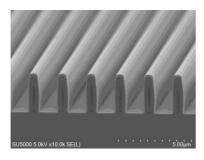
PRESS RELEASE



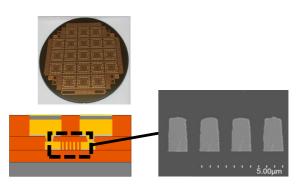
■参考写真



高解像度感光性絶縁材料



高耐熱・高解像度フォトレジスト (イオン注入後のレジスト形状)



高解像度感光性絶縁材料



高透明・高耐熱PFASフリーフィルム